

# TEPLEM INDUKOVANÁ MODIFIKACE GENERACE DRUHÉ HARMONICKÉ V $\text{Si}_3\text{N}_4$ TENKÝCH VRSTVÁCH

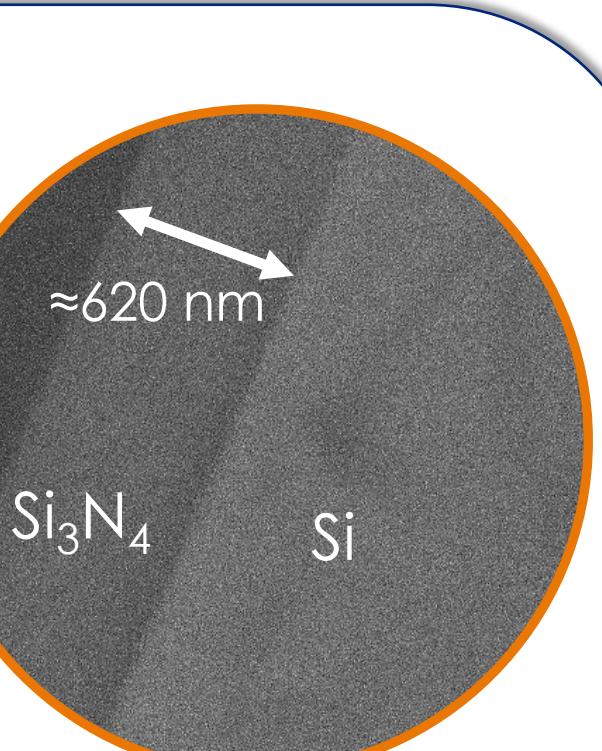
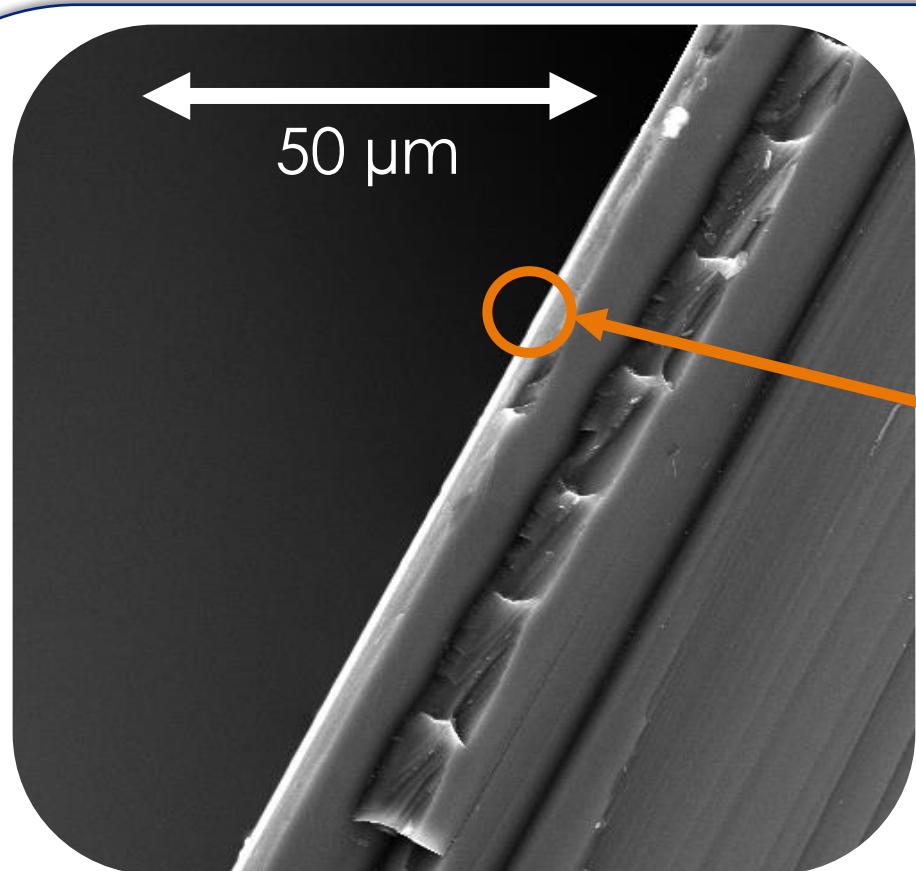
Jakub Lukeš<sup>1,2</sup>, Karel Žídek<sup>1</sup>

1 Výzkumné centrum TOPTEC, Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky, Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha

2 Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

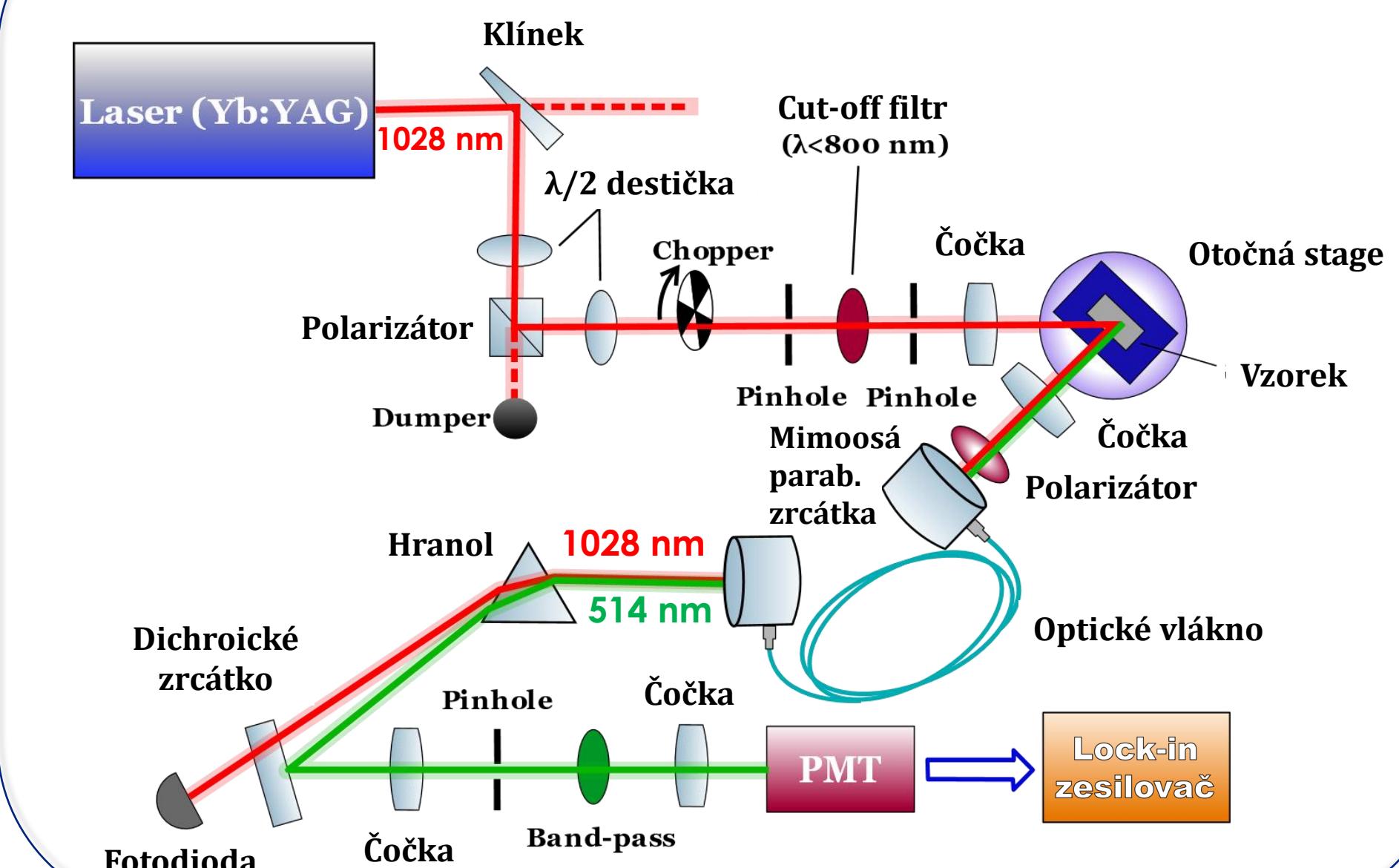


**SKFM 2023**

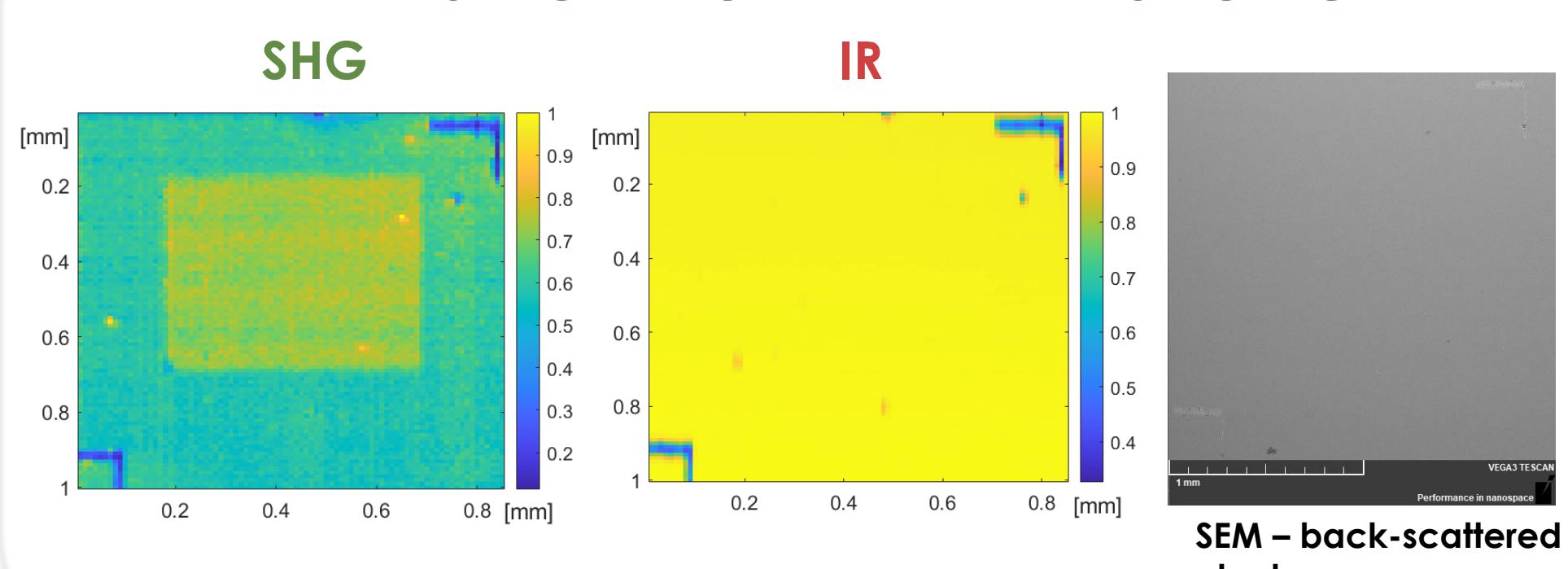


- Pozorovány opticky indukované změny SHG na  $\text{Si}_3\text{N}_4$  a  $\text{SiO}_x\text{N}_y$  tenkých vrstvách deponovaných na substrátu Si
- Změny zkoumány v závislosti na různých parametrech
- Jako pravděpodobná příčina zjištěna teplem indukovaná změna v mechanickém napětí ve vrstvě

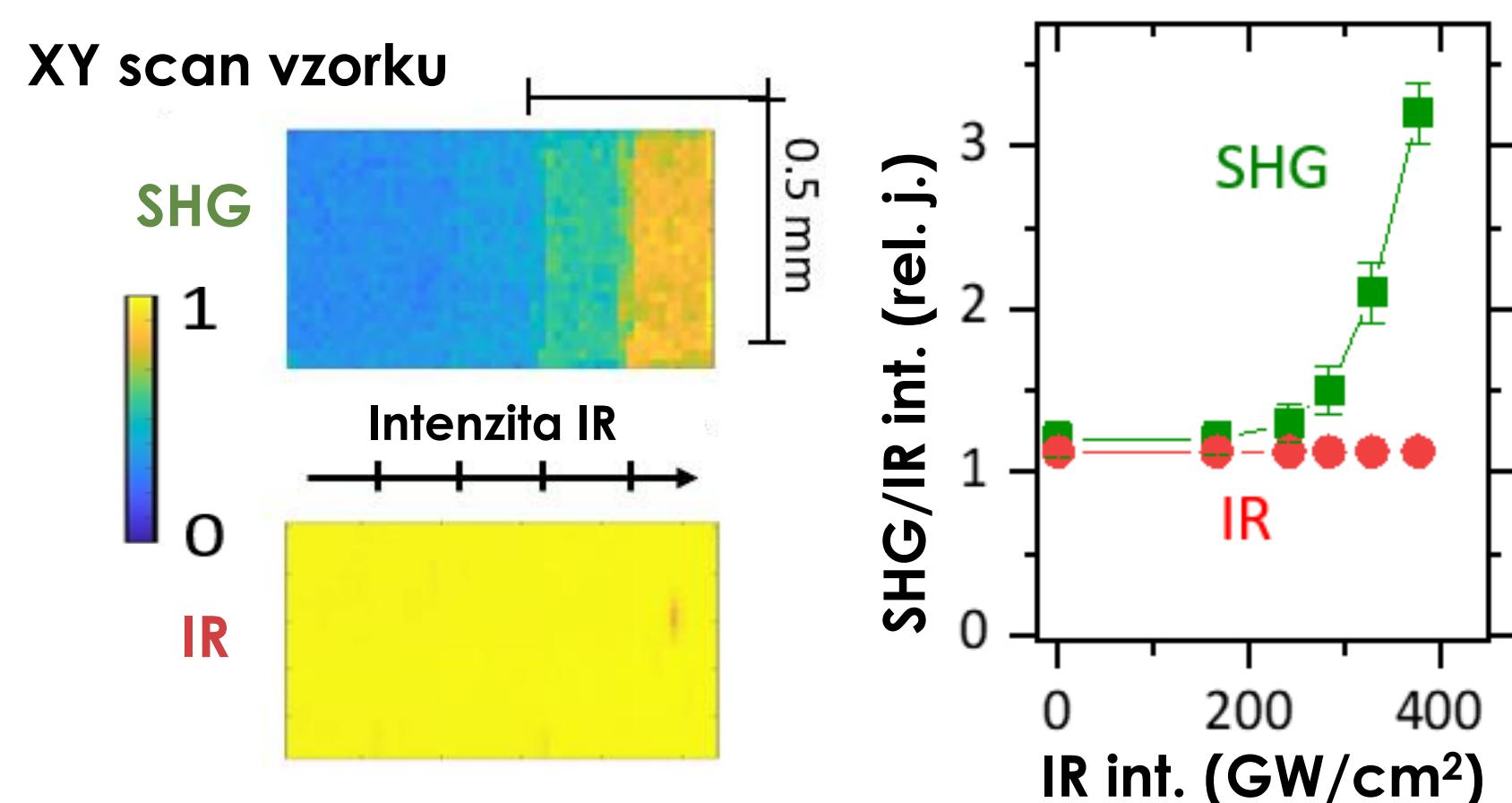
## MĚŘÍCÍ SESTAVA



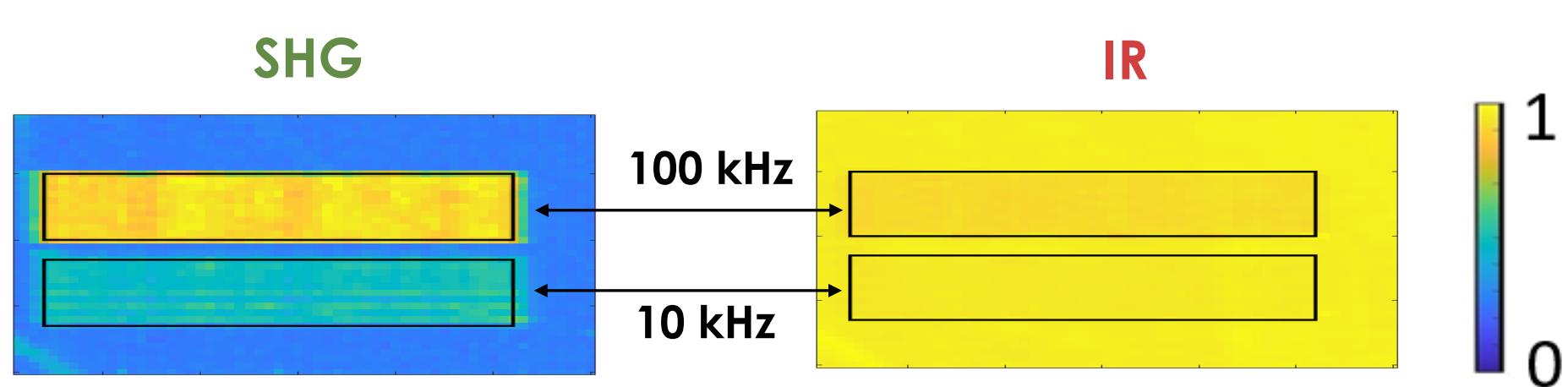
## ZMĚNY V SHG A ODRAŽENÉ SLOŽCE IR



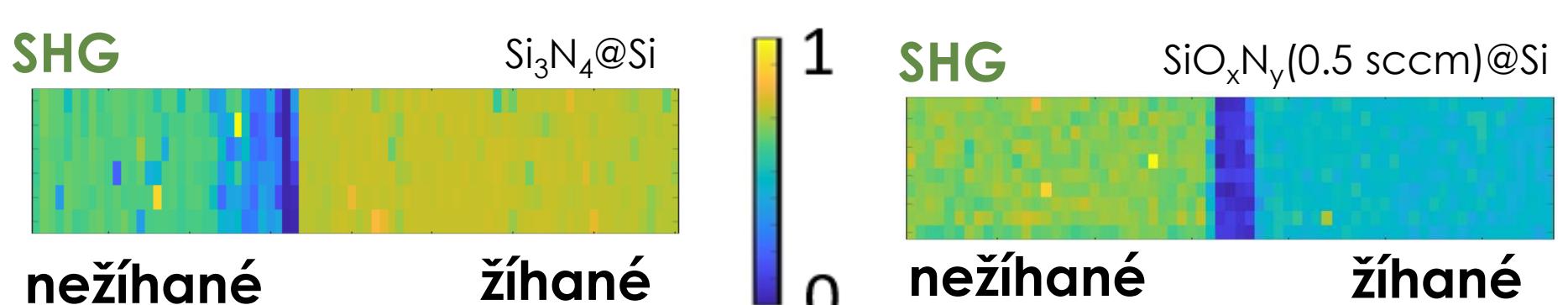
## SHG V ZÁVISLOSTI NA INTENZITĚ IR



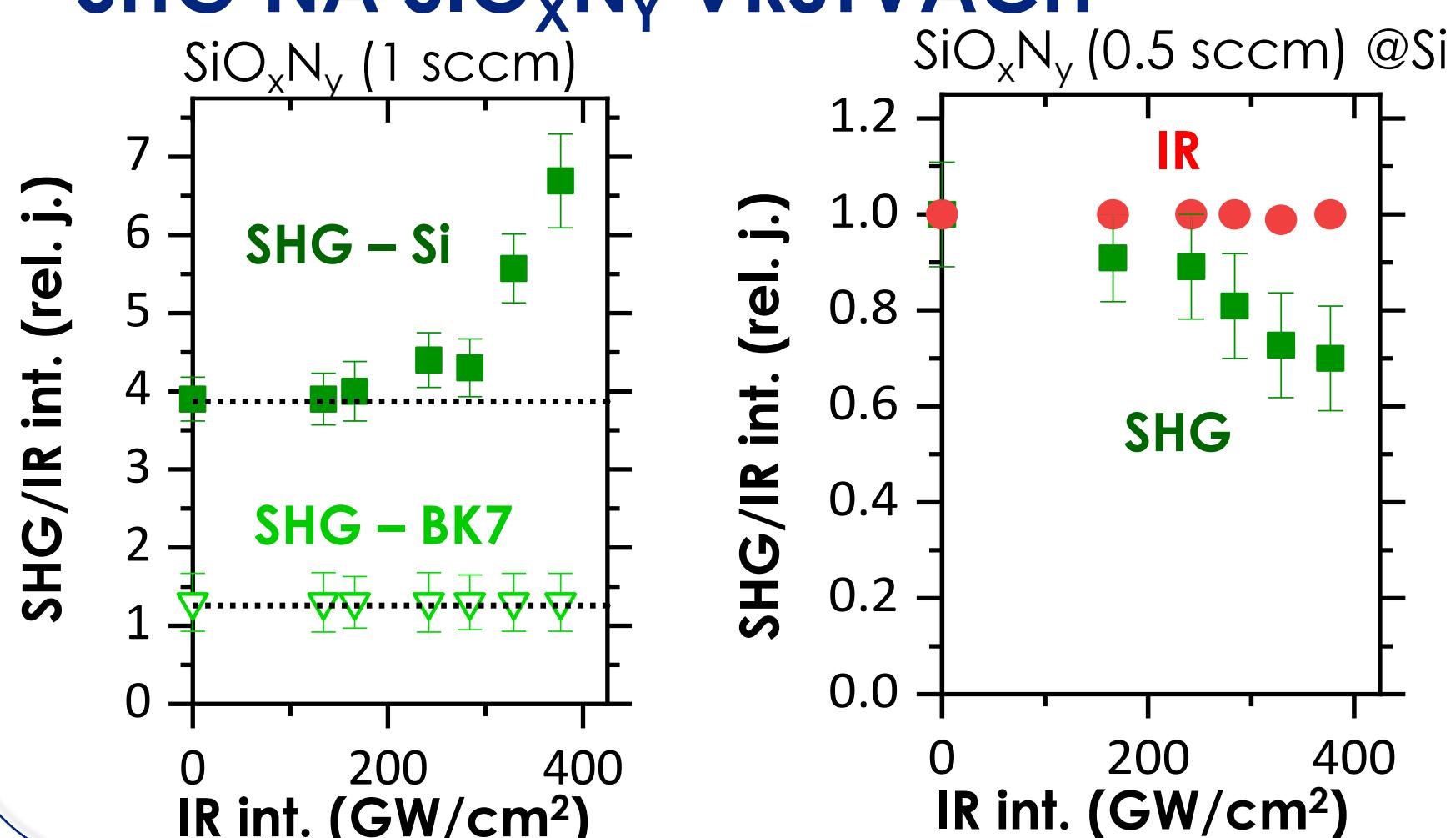
## SHG V ZÁVISLOSTI NA OPAKOVAČÍ FREKVENCE



## TEPLEM INDUKOVANÉ ZMĚNY SHG



## SHG NA $\text{SiO}_x\text{N}_y$ VRSTVÁCH



## REFERENCE

- J. Lukeš , V. Kanclíř, J. Václavík, R. Melich, U. Fuchs a K. Žídek. Optically modified second harmonic generation in silicon oxynitride thin films via local layer heating. *Sci Rep* 13, 8658 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41598-023-35593-8>
- N. K. Das, V. Kanclíř, P. Mokrý, and K. Žídek, "Bulk and interface second harmonic generation in the  $\text{Si}_3\text{N}_4$  thin films deposited via ion beam sputtering," *J. Opt.* 23, 024003 (2021).
- O. Yakar, E. Nitiss, J. Hu, C.-S. Brès, "Generalized Coherent Photogalvanic Effect in Coherently Seeded Waveguides," *Laser Photonics Rev*, 16, 2200294 (2022).